

令和3年度 ナノテクキャリアアップアライアンス 京都大学 電子線描画装置 入門コース

■ 目的：

近年、微細加工技術で大いに注目を集めているのが MEMS・NEMS 技術であり、既に様々な分野で研究・開発・実用化が進んでいます。特に、センサ・情報通信・医療・バイオなどの分野で著しい発展をとげています。この技術の中で、微細構造作製におけるキープロセスのひとつが、電子線描画です。

本コースにおいては、微細加工の初心者を対象にし、最新鋭電子線描画装置を使用した Si ウェハへの描画をメインに、Si ドライエッチング装置による微細加工や FE-SEM による加工後の微細構造観察も含め、微細加工のための基本技術習得を目指します。

■ 募集人数：

3名

■ 期間：

令和3年7月26日(月)～7月28日(水)
(座学：0.5日間、実習：2日間 計2.5日間)

■ 会場：

京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点
京都市左京区吉田本町 京都大学吉田キャンパス 工学部物理系校舎3階327号
URL: <http://www.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp/access/>

■ 内容：

1日目： 7月26日(月) 午後

- ① 電子線描画の基礎(座学)
(電子線描画の概要、装置、描画方式、プロセス、位置合わせ 等)

3日目： 7月27日(火)

- ② CADによるパターン設計(実習)
- ③ 基板準備と電子線描画装置による描画(実習)
- ④ 描画パターンの現像(実習)

4日目： 7月28日(水)

- ⑤ Siドライエッチング加工(実習)
- ⑥ 加工構造のFE-SEM観察(実習)

■ 受講料：

14,000円

■ 問合せ・申込先：

京都大学 CUPAL事務局
京都市西京区京都大学桂C3棟
京都大学工学研究科 ナノ・マイクロシステム工学研究室内(担当:河野)
TEL: 075-383-3693
E-mail: cupal@nms.me.kyoto-u.ac.jp